



如果您的收信軟體不支援html格式的文件、或是您無法正常看到以下內容，請按此：

What 智慧局為您做些什麼

- 2011.01版國際專利分類相關資料請參考本...
- 發明公開公報自100年11月1日起將以最新...
- 舉辦100年國家發明創作獎得獎作品展示宣...
- 舉辦2011臺港兩地「短片由我創」製作大...
- 專利資訊檢索暨應用推廣研討會
- 本局舉辦「24小時原創不打烊」活動，歡...
- 本局電子申請推動現況

活動回顧

- 商標合理使用案例介紹—以營業招牌看板...
- 要如何證明自己是著作權人之說明
- 專利侵權人就訂定和解契約前之侵權商品...

Global 國際風向球

- 美國總統歐巴馬簽署通過美國專利法改革...
- 英國貿易暨投資署(UKTI)出版「韓歐盟FT...

國際風向球

2011年台北國際發明暨技術交易展展現創意

2011年台北國際發明暨技術交易展於9月29日至10月2日在台北世貿展覽一館，展出各種創意巧思與專業技術，展現我國產業創新研發實力與成果。今年共有來自23個國家，近700家廠商、發明人、研發單位及學術單位參展，展出攤位數多達1,000個，不論參展國家數或展出規模皆創下歷年新高，堪稱亞洲最具指標性的國際發明暨技術交易展，更是台灣最大的智慧財產與技術交易的交流平台。

本展已邁入第7年，由經濟部、國防部、教育部、行政院國科會及農委會共同主辦，展場分發明競賽區及技術交易區2大專區，其中「發明競賽區」本局「發明創新館」展出100年國家發明創作獎得獎專利作品，另有結合太陽能的各項發明品及各式各樣改善生活機能、提升智慧生活品質的創新發明。「技術交易區」內則有13個展示專館約180家機構，獨家展出榮獲美國R&D100、美國 IDEA AWARD、波蘭國家特別獎、德國 iF Design Award及Reddot Product Design Award等設計展得獎作品，及瑞士日內瓦國際發明展、韓國首爾國際發明展與美國匹茲堡等國際發明展得獎作品。

本次參展作品具各種創新之發明作品，包括獲得美國INPEX匹茲堡發明展金牌獎的「以遠紅外線陶瓷製作高效率LED散熱基板」，在瑞士日內瓦國際發明展獲得金牌的發明品—會說話的「語音聲控咖啡機」等。更多展覽相關資訊請至<http://www.InvenTaipei.com.tw>或<http://www.twtm.com.tw/2011tech/>網站查詢。

台北國際發明暨技術交易展 <http://www.InvenTaipei.com.tw>

台北國際發明暨技術交易展 <http://www.twtm.com.tw/2011tech/>

智慧財產權月刊

2011年專利業務新措施之法制探討

隨著網路科技之發達和對專利資訊之日益重視，對於閱覽專利歷程文件之便利性和服務質量之需求也大幅增加。繼美國專利商標局、歐洲專利局和日本特許廳開放民眾透過網路閱覽專利歷程文件後，本局也自100年3月1日起提供「專利審查公開資訊查詢功能」之電子服務。

美、歐、日等國已開放網路查詢專利歷程文件多年，其個人資料保護法制亦相當成熟，但個人資料保護議題從未成為阻礙其辦理專利資訊公開的因素。申請人應認知申請專利之行為將導致個人資料公開，避免填寫不必要之個人資料或採取保護措施，對於較具私密性或敏感性之個人資料並宜以獨立文件提出，主動告知專利專責機關進行保密。如何同時兼顧專利資訊公開及合理保護個人資料，則有賴專利專責機關和專利申請人之共同合作，由白杰立所撰寫的「專利資訊公開與個人資料保護」專文，首先介紹美國、歐洲及日本等國對於專利資訊公開和保護個人資料之制度及運作方式，接著針對各國與我國在專利資訊與個人資料保護法及個人資料保護法之關係進行比較，期能作為我國處理相關議題之參考，十分值得一讀。

專利申請案如符合專利法之規定而給予專利權者，即取得排除他人實施之權利，並受到國家法律之特別保護，基於「使用者、受益者付費」之原則，提出專利申請應繳納申請費，專利申請案經核准後應繳納證書費及專利年費，各項規費金額係規定於「專利規費收費準則」，該準則於70年10月2日發布，前後歷經九次修正，最近一次於100年7月1日施行，由王綉娟所撰寫的「專利規費修正之探討」專文，分別針對新式樣專利年費及發明專利實體審查費等二項專利規費之重大修正歷程進行介紹及探討。作者首先針對產業界持續反應專利規費金額較諸外國偏高之新式樣專利，彙整並比較我國100年7月1日調降規費前後與美國、日本、歐洲、韓國、中國大陸及澳洲等國之新式樣專利規費金額之排序，接著觀察93年以來各年度發明專利及新式樣專利申請案件數，可知新式樣專利之申請案件數呈逐年遞減之趨勢，故須調降新式樣專利總費用，以刺激產業界之申請意願。此外，作者另針對99年1月1日起施行發明專利實體審查費採逐項收費制後之後續效應進行分析，內容精闢，值得參考。.....more

美國專利法上化學發明之非顯而易知性研究（下）

對於化學發明之非顯而易知性判斷，除了顯示新化合物係非與已知化合物結構充分近似，或先前技術未提供建議或動機引發製造新的化合物，或獲得新化合物的可信賴的方法之外，申請人還可以藉由顯示新化合物具有不可預期的性質，以反駁顯而易知性的推定。然而，常常新產生的化合物與先前技術類似化合物的不同處，一是具有相同性質但有程度上之差異，另一是所具有的新性質是伴隨共同性質而來，延續上期由鄭煜騰所撰寫的「美國專利法上化學發明之非顯而易知性研究（下）」論述，繼續從表面證據明顯之反駁、KSR案對化學發明的影響、我國醫藥相關發明之進步性等主題進行深入剖析與探討，十分值得一讀。.....more

論著作權侵害『接觸』要件之研究--以美國法為中心（上）

我國在實務、學說認為判斷著作權侵害之要件有二，一為被告是否曾「接觸」著作權人之著作；另一為被告之著作與著作權人之著作是否「實質相似」。然而，問題在於如何證明「接觸」？是否僅提出被告有合理之機會「聽」或「看」原告著作之證據為已足？應如何舉證證明被告有合理之機會「聽」或「看」著作權人著作？被告主張有獨立創作之事實，是否表示被告未「接觸」原告著作？「獨立創作」與「接觸」之間關聯性為何？由胡中璋所撰寫的「論著作權侵害『接觸』要件之研究——以美國法為中心（上）」論述，深入探討美國著作權法對於「接觸」要件之看法與見解，並透過美國實務與學說對於「獨立創作」之觀點，以釐清「接觸」與「獨立創作」之間的關聯性。本文篇幅較長，分為上下二篇刊出，本期為上篇。.....more

[>> 出版品購買資訊](#) >> [研討會登錄中心](#)

[>> 月刊徵稿簡則](#) >> [訂閱「專利商品化網站」技術快訊](#)

[訂閱電子報](#)

[聯絡我們](#)

[取消訂閱](#)

若對智慧財產權電子報有任何建議或疑問，歡迎與我們聯絡！

臺北市大安區106辛亥路2段185號3樓。服務時間上午：08:30~12:30、下午：1:30~5:30

服務電話：02-27380007(總機)、02-23766128。